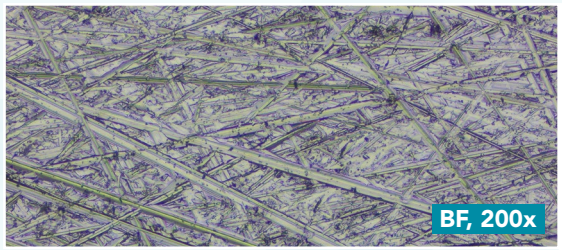
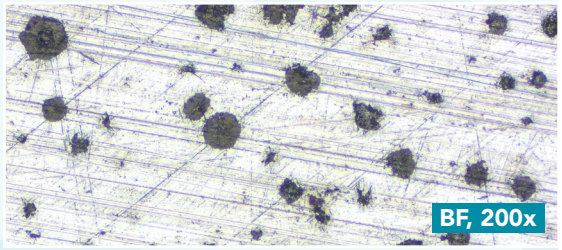
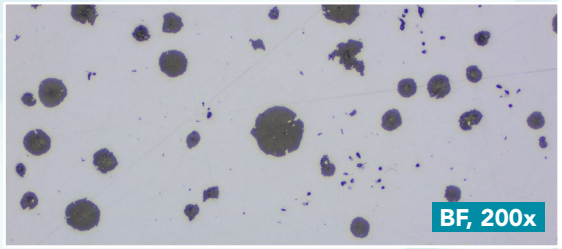
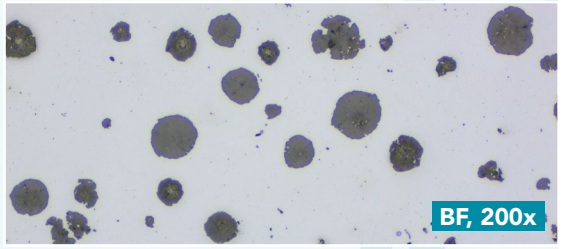
Aka-Brief **#14 Fonte et Fer**

AKASEL
THE SMARTER ALTERNATIVE

1	Piatto 220	Water	300 rpm	30 N	Until plane	
2	Allegran 3	DiaUltra 9 µm	150 rpm	35 N	3:30 min	
3 ***	Silk	DiaUltra 3 µm	150 rpm	30 N	2:30 min	
4 * *** ****	Chemal**	Colloidal Silica 50 nm Alkaline	150 rpm	15 N	1:00 min	

Les temps sont indiqués pour un système de préparation de 300 mm et les forces pour un échantillon individuel de 40 mm de diamètre.

Sur un système de 250 mm, les temps doivent être augmentés de 30 %, sur un système de 200 mm de 100 %. La force doit être augmentée pour les échantillons plus grands et diminuée pour les échantillons plus petits.

La vitesse de rotation de la tête (porte-échantillon ou plaque porte-échantillon) utilisée est de 150 tr/min.

Le temps et la force peuvent varier en fonction de l'équipement.

* L'étape 4 est facultative.

Avant le polissage aux oxydes, le tissu de polissage doit être mouillé avec de l'eau jusqu'à ce que le support touche le tissu de polissage. Pendant les 10 dernières secondes l'étape de polissage à l'oxyde, le drap de polissage doit être rincé à l'eau pour nettoyer à la fois le(s) échantillon(s) et le drap de polissage.

Le polissage à l'oxyde donne un résultat sans rayures mais introduit un certain relief. Pour minimiser le relief, cette étape peut être remplacée par une étape finale utilisant DiaUltra 1 µm sur un tissu de polissage Napal. Pour les échantillons sensibles à l'eau, seul le polissage au diamant est recommandé en utilisant des suspensions/lubrifiants sans eau pour les étapes de 3 et 1 µm.

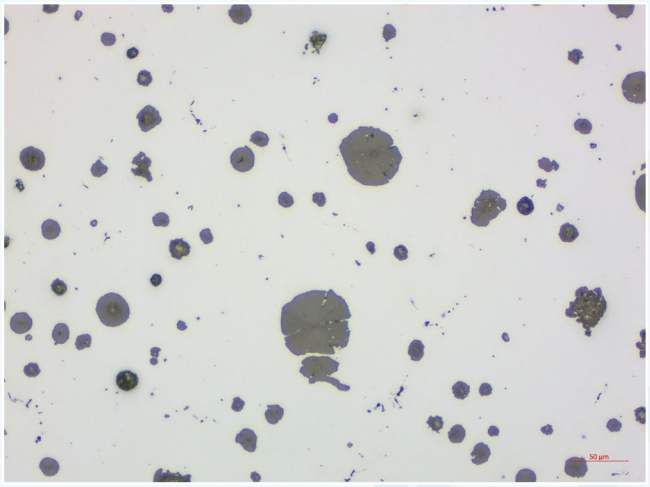
L'utilisation d'eau doit également être évitée pour le nettoyage après ces étapes de préparation.

Veillez à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires lors de la manipulation des produits chimiques.

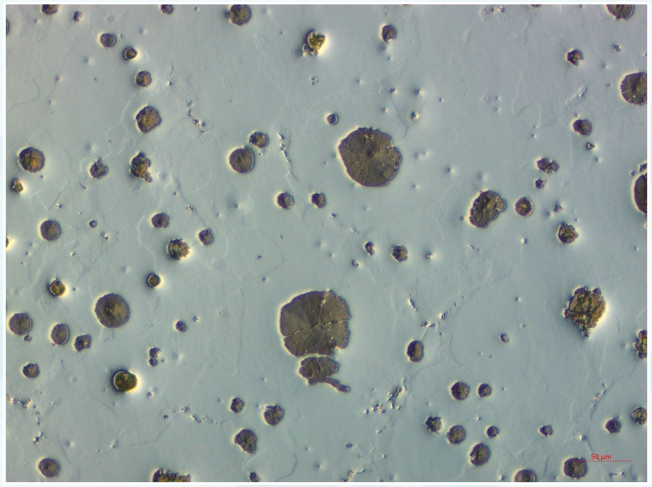
SOMECO

Aka-Brief #14 Fonte et Fer

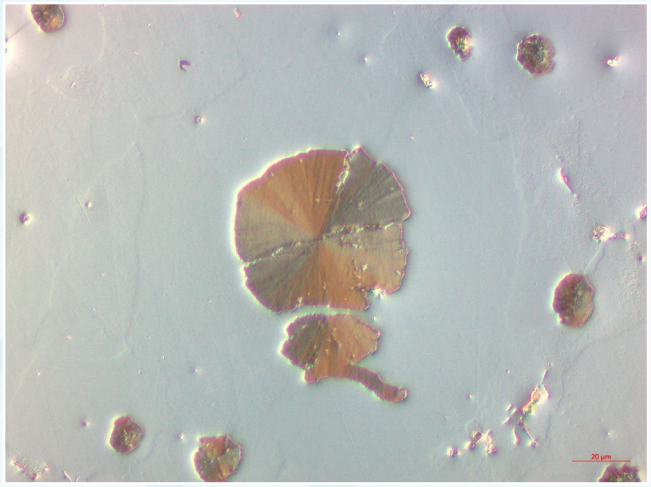
RÉSULTAT FINAL



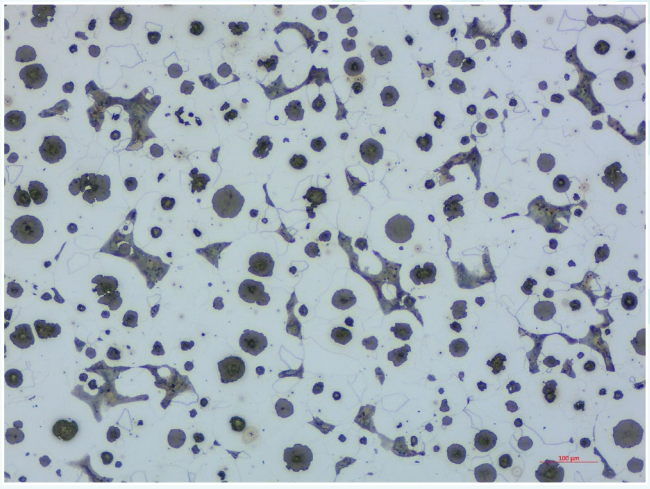
BF, 200x



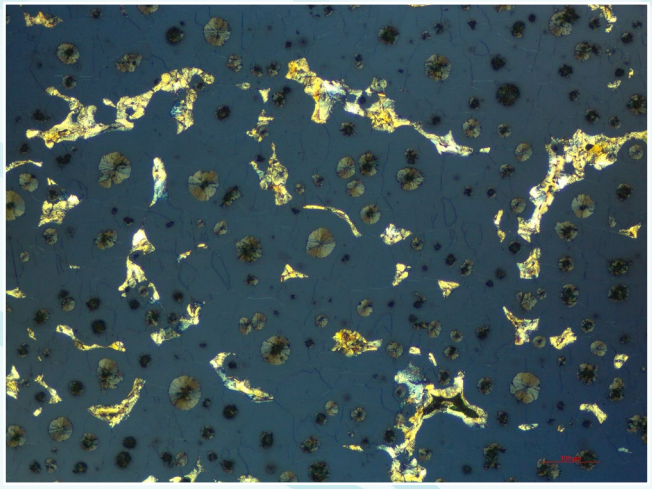
DIC, 200x



DIC, 500x



Etched with Nital 3%, BF, 200x



Etched with Nital 3%, POL, 200x